

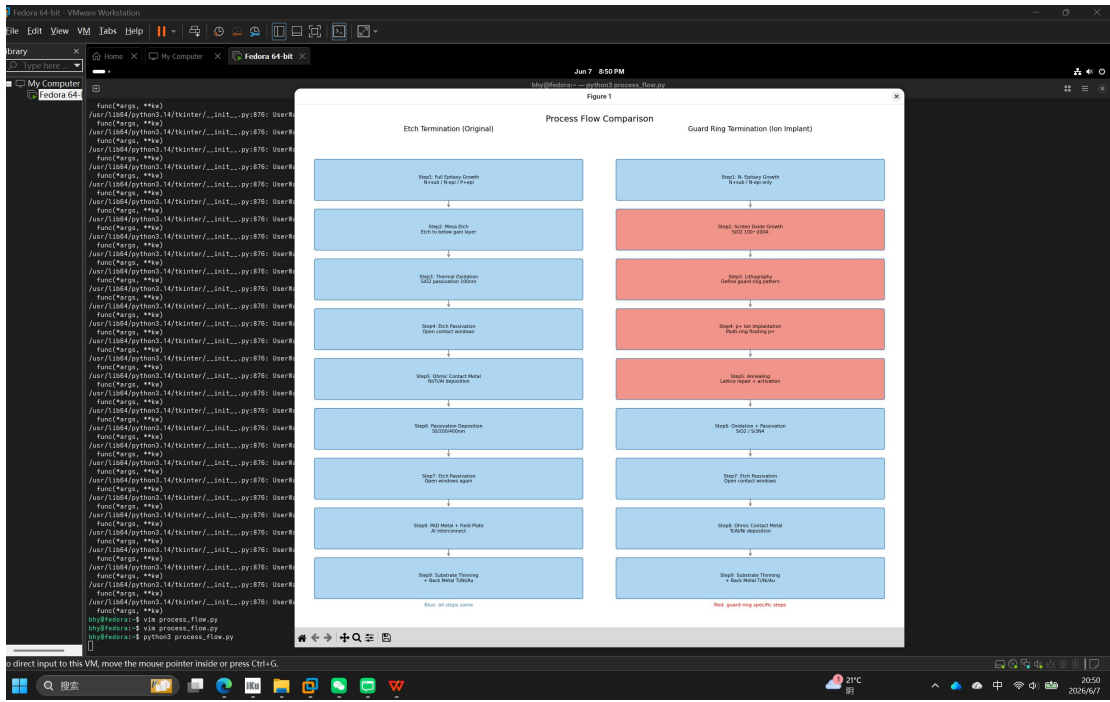
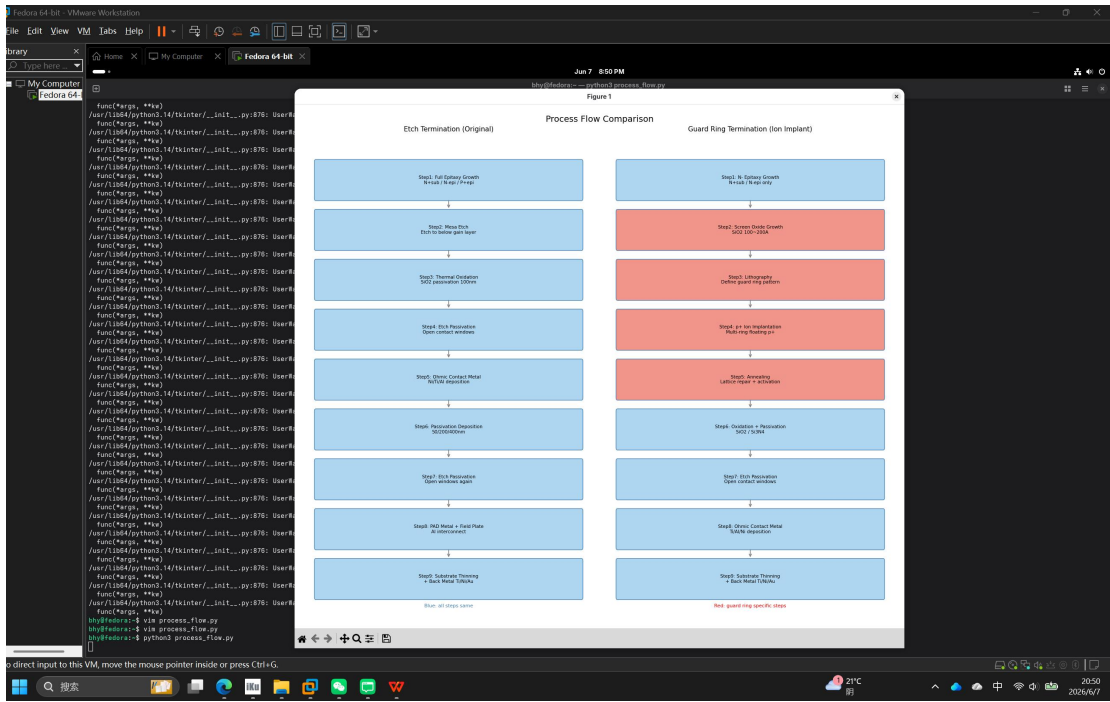
第 1 题：保护环终端器件工艺流程

与刻蚀终端的核心区别

刻蚀终端通过物理刻蚀台面来控制边缘电场，而保护环终端改用多圈浮空 p+注入环分散边缘电场，不需要刻蚀台面结构。

保护环终端工艺流程（共 9 步）

- ① **N-外延层生长** 在 N+衬底上生长 N-外延层。由于不需要全外延结构，省去了 P+外延层的生长步骤，工艺相对简化。
- ② **生长屏蔽氧化层** 在硅表面生长约 100~200Å 的薄 SiO₂层，作用是减小后续离子注入时的沟道效应，使掺杂分布更均匀可控。
- ③ **光刻定义保护环区域** 用光刻工艺在屏蔽氧化层上开窗口，定义多圈 p+保护环的位置。保护环一般设计为围绕主结的多个同心环，间距逐渐增大。
- ④ **p+保护环离子注入** 向定义好的区域注入 p 型掺杂离子（如硼），形成多圈浮空 p+环。这些环通过调制耗尽层形状来分散边缘峰值电场，提高击穿电压。
- ⑤ **高温退火** 离子注入后进行退火，修复晶格损伤，激活掺杂原子，使其进入替代位并有效提供载流子。
- ⑥ **热氧化 + 钝化层沉积** 生长 SiO₂并沉积 Si₃N₄钝化层，对器件表面进行保护，防止污染和漏电。
- ⑦ **刻蚀钝化层开窗口** 在欧姆接触区域刻蚀掉钝化层，暴露出需要形成金属接触的区域。
- ⑧ **欧姆接触金属沉积** 在开窗区域沉积 Ti/Al/Ni 等金属，经退火处理形成良好的欧姆接触电极。
- ⑨ **衬底减薄 + 背面金属沉积** 将衬底减薄至目标厚度，在背面沉积 Ti/Ni/Au 金属层，形成背面电极。



第 2 题：刻蚀终端器件光刻板版图

刻蚀终端器件共需 4~5 块光刻掩膜版，每块对应一道关键光刻工序，各层之间需要精确对准。

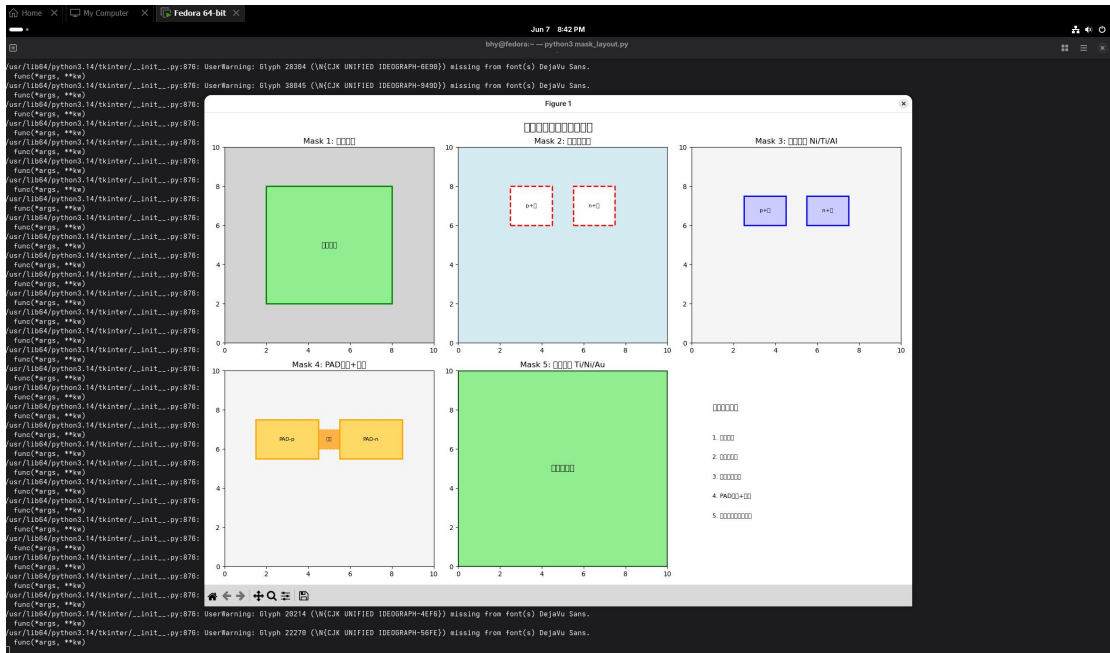
Mask 1: 台面刻蚀版 定义器件有源区。保留区域为中心台面（有源区），周边区域通过刻蚀去除外延层至增益层以下，形成台面终端结构。对准标记在此层首次定义，供后续各层对准使用。

Mask 2: 钝化层开窗版 在 SiO_2 钝化层上开出欧姆接触窗口。用虚线框标示需要去除 SiO_2 的区域，p+和 n+区域分别独立开窗，需与 Mask 1 精确对准。

Mask 3: 欧姆接触金属版 定义 Ni/Ti/Al 欧姆接触电极的图形。金属图形略小于开窗区域，采用 Lift-off 或刻蚀工艺形成，退火后在 p+和 n+区域分别形成良好的欧姆接触。

Mask 4: PAD 金属 + 场板版 定义 Al 互连金属、焊盘及场板图形。PAD 为最终焊线区域，场板延伸覆盖台面边缘，用于降低边缘峰值电场，提高器件可靠性。Al 厚度通常为 $2\sim 4\mu\text{m}$ 。

Mask 5: 背面金属版（通常全面覆盖） 衬底减薄后在背面蒸发或溅射 Ti/Ni/Au 金属层，一般为全面积覆盖，无需图形化，通常不需要单独的光刻版。



```

import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.patches as mpatches

fig, axes = plt.subplots(1, 5, figsize=(10, 10))
fig.suptitle('利用掩膜显示光栅图像', fontsize=10)

# Mask 1: 简单矩形
ax = axes[0]
ax.set_xlim(0, 10)
ax.set_ylim(0, 10)
ax.add_patch(mpatches.Rectangle((0, 0), 10, 10, color='lightgray'))
ax.add_patch(mpatches.Rectangle((2, 2), 8, 8, color='green', lw=2))
ax.set_title('Mask 1: 简单矩形')
ax.text(0.5, 0.5, '简单矩形', ha='center', va='center', fontsize=8)

# Mask 2: 两个矩形
ax = axes[1]
ax.set_xlim(0, 10)
ax.set_ylim(0, 10)
ax.add_patch(mpatches.Rectangle((0, 0), 10, 10, color='lightblue', alpha=0.5))
ax.add_patch(mpatches.Rectangle((2, 2), 4, 4, color='white', lw=2, ls='--'))
ax.add_patch(mpatches.Rectangle((6, 6), 4, 4, color='white', lw=2, ls='--'))
ax.set_title('Mask 2: 两个矩形')
ax.text(0.5, 0.5, '两个矩形', ha='center', va='center', fontsize=8)

# Mask 3: 两个矩形
ax = axes[2]
ax.set_xlim(0, 10)
ax.set_ylim(0, 10)
ax.add_patch(mpatches.Rectangle((0, 0), 10, 10, color='lightgray', alpha=0.5))
ax.add_patch(mpatches.Rectangle((2, 2), 4, 4, color='blue', lw=2))
ax.add_patch(mpatches.Rectangle((6, 6), 4, 4, color='blue', lw=2))
ax.set_title('Mask 3: 两个矩形')
ax.text(0.5, 0.5, '两个矩形', ha='center', va='center', fontsize=8)

# Mask 4: 两个矩形+掩膜
ax = axes[3]
ax.set_xlim(0, 10)
ax.set_ylim(0, 10)
ax.add_patch(mpatches.Rectangle((0, 0), 10, 10, color='lightgray'))
ax.add_patch(mpatches.Rectangle((2, 2), 4, 4, color='orange', lw=2))
ax.add_patch(mpatches.Rectangle((6, 6), 4, 4, color='orange', lw=2))
ax.set_title('Mask 4: 两个矩形+掩膜')
ax.text(0.5, 0.5, '两个矩形+掩膜', ha='center', va='center', fontsize=8)

# Mask 5: 简单矩形
ax = axes[4]
ax.set_xlim(0, 10)
ax.set_ylim(0, 10)
ax.add_patch(mpatches.Rectangle((0, 0), 10, 10, color='lightgray', alpha=0.5))
ax.add_patch(mpatches.Rectangle((2, 2), 8, 8, color='green', lw=2))
ax.set_title('Mask 5: 简单矩形')
ax.text(0.5, 0.5, '简单矩形', ha='center', va='center', fontsize=8)

# 空白掩膜显示
ax = axes[5]
ax.set_xlim(0, 10)
ax.set_ylim(0, 10)
ax.text(0.5, 0.5, '空白掩膜显示', fontsize=10, transform=ax.transAxes)
ax.text(0.5, 0.5, '1. [Green rectangle]', fontsize=8, transform=ax.transAxes)
ax.text(0.5, 0.5, '2. [Two red dashed rectangles]', fontsize=8, transform=ax.transAxes)
ax.text(0.5, 0.5, '3. [Two blue rectangles]', fontsize=8, transform=ax.transAxes)
ax.text(0.5, 0.5, '4. [Two yellow rectangles]', fontsize=8, transform=ax.transAxes)
ax.text(0.5, 0.5, '5. [Green rectangle]', fontsize=8, transform=ax.transAxes)

```